V. 87, N 2

MARCH — APRIL  $20\overline{20}$ 

## ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, ФОТОУПРУГОСТИ И ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ДИФРАКЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОПУСКАЮЩИХ ГОЛОГРАММ В ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>

М. А. Аманова\*, В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич, В. Н. Навныко

УДК 535.4:548.0

Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина, 247760, Беларусь, Мозырь; e-mail: maral amanova@mail.ru

## (Поступила 15 января 2020)

Представлены результаты теоретических исследований зависимости дифракционной эффективности пропускающих голограмм, сформированных в образце фоторефрактивного кристалла Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>, от ориентационного угла, удельного вращения кристалла и его толщины. В теоретической модели учтены линейный электрооптический, обратный пьезоэлектрический и фотоупругий эффекты. Показано, что при изменении знака оптической активности кристалла может иметь место смещение максимумов дифракционной эффективности относительно значений ориентационного угла.

Ключевые слова: фоторефрактивный кристалл, линейный электрооптический эффект, обратный пьезоэлектрический эффект, фотоупругость, оптическая активность, дифракционная эффективность, Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>.

The results of a theoretical study of the dependence of the diffraction efficiency of a transmission hologram formed in a sample of a  $Bi_{12}SiO_{20}$  photorefractive crystal on the orientation angle, specific rotation of the crystal, and its thickness are presented. The theoretical model takes into account linear electrooptical, inverse piezoelectric and photoelastic effects. It is shown that with a change in the sign of the specific rotation of the crystal, there can be a shift of the maximums of diffraction efficiency relative to the orientation angle.

*Keywords:* photorefractive crystal, linear electro-optical effect, inverse piezoelectric effect, photoelasticity, optical activity, diffraction efficiency, Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>.

**Введение.** С момента открытия явления фоторефракции в кристаллах силленитов с 1966 до 1982 гг. электрооптический эффект считался основным механизмом формирования решетки показателя преломления при освещении кристалла интерференционной картиной. В 1986 г. были представлены результаты экспериментальных исследований характеристик голографических решеток в одноосном кристалле ниобата лития LiNbO<sub>3</sub> [1] и показано, что удовлетворительное объяснение полученных закономерностей может быть выполнено лишь при одновременном учете линейного электрооптического, обратного пьезоэлектрического эффектов и фотоупругости кристалла. Одновременную совокупность обратного пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов для простоты в этих случаях принято сокращенно называть "пьезоэффектом". В 1987 г. впервые рассмотрено влияние обратного пьезоэлектрического эффекта и фотоупругости на свойства голограмм в кубических кристаллах [2]. При этом не учтено явление оптической активности, которое присуще кубическим фоторефрактивным кристаллам силленитов класса симметрии 23. К моменту выхода работы [2] была развита технология [3] решения голографических задач матричным методом с использованием теории гиротропии,

## INFLUENCE OF INVERSE PIEZOELECTRIC EFFECT, PHOTOELASTICITY, AND OPTICAL ACTIVITY ON THE DIFFRACTION EFFICIENCY OF TRANSMISSING HOLOGRAMS IN PHOTOREFRACTIVE CRYSTAL Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>

**M. A. Amanova<sup>\*</sup>**, **V. V. Shepelevich, A. V. Makarevich, V. N. Navnyko** (*I. P. Shamyakin Mozyr State Pedagogical University, Mozyr, 247760, Belarus; e-mail: maral\_amanova@mail.ru*)

разработанной академиком Ф. И. Федоровым и его учениками (см., например, [4, 5]). В 1986 г. [6] в рамках электрооптического механизма фоторефракции с использованием ковариантных методов [7] рассчитаны выходные характеристики голографической решетки, записанной в оптически активном кубическом кристалле  $Bi_{12}SiO_{20}$  (BSO) среза (110) при ориентации вектора решетки параллельно кристаллографическому направлению [001]. В [8] впервые показано, что учет обратного пьезоэлектрического эффекта и фотоупругости приводит в кубических оптически активных кристаллах не к малым поправкам в теоретических результатах, полученных при учете только электрооптического эффекта, а кардинально (качественно) изменяет описание дифракции в кристалле. Однако анализ закономерностей влияния удельного вращения на дифракционную эффективность пропускающих голограмм не проводился. Следует отметить, что после исследований [9—12] задача учета пьезоэффекта в фоторефрактивных кристаллах при расчете энергетических и поляризационных характеристик пропускающих голограмм решалась рядом авторов; например, в [13, 14] получены дополнительные экспериментальные данные, подтверждающие результаты [8, 10].

Цель настоящей работы — анализ закономерностей влияния гиротропных и пьезоэлектрических свойств кубических фоторефрактивных кристаллов класса симметрии 23 среза (110) на зависимость дифракционной эффективности пропускающих голографических решеток от удельного вращения ρ и ориентационного угла θ.

**Теоретические расчеты.** Рассмотрим влияние электрооптического эффекта, обратного пьезоэлектрического эффекта, фотоупругости и оптической активности на дифракционную эффективность голограммы, записанной в кристалле BSO толщиной 8 мм. Использованы параметры кристалла BSO: электрооптический коэффициент  $r_{41} = -5$  пм/В; пьезоэлектрический коэффициент  $e_{14} = 1.12$  Кл/м<sup>2</sup>; коэффициенты упругости  $c_1 = 12.96 \cdot 10^{10}$  H/м<sup>2</sup>,  $c_2 = 2.99 \cdot 10^{10}$  H/м<sup>2</sup>,  $c_3 = 2.45 \cdot 10^{10}$  H/м<sup>2</sup>; фотоупругие постоянные  $p_1 = -0.16$ ,  $p_2 = -0.13$ ,  $p_3 = -0.12$ ,  $p_4 = -0.015$ ; показатель преломления n = 2.54 [15]. Амплитуда напряженности электрического поля пространственного заряда  $E_{SC} = 5 \cdot 10^4$  В/м в соответствии с [15]. Дифракционная эффективность голограммы:

$$\eta(d) = \frac{S_{\perp}^{2}(d) + S_{\parallel}^{2}(d)}{R_{\perp}^{2}(0) + R_{\parallel}^{2}(0)} \cdot 100\%, \qquad (1)$$

где d — толщина кристалла;  $R_{\perp}(0)$  и  $R_{\parallel}(0)$  — проекции векторной амплитуды восстанавливающей голограмму волны R на направления, перпендикулярное плоскости падения и лежащее в плоскости падения на входе в кристалл;  $S_{\perp}(d)$  и  $S_{\parallel}(d)$  — аналогичные проекции векторной амплитуды восстановленной волны S на выходе из кристалла толщиной d.

Зависимость дифракционной эффективности от ориентационного угла θ и удельного вращения р кристалла при двухволновом взаимодействии нетрудно получить путем решения связанных уравнений:

$$\begin{aligned} R'_{\perp} &= \rho R_{\parallel} + \kappa_1 S_{\perp} + \kappa_2 S_{\parallel}, \\ R'_{\parallel} &= -\rho R_{\perp} + \kappa_2 S_{\perp} + \kappa_3 S_{\parallel}, \\ S'_{\perp} &= -\kappa_1 R_{\perp} - \kappa_2 R_{\parallel} + \rho S_{\parallel}, \\ S'_{\parallel} &= -\kappa_2 R_{\perp} - \kappa_3 R_{\parallel} - \rho S_{\perp}. \end{aligned}$$

$$(2)$$

Здесь  $R_{\perp}$  и  $S_{\perp}$  — проекции векторных амплитуд опорной и предметной световых волн на единичный вектор, перпендикулярный плоскости падения;  $R_{\parallel}$  и  $S_{\parallel}$  — проекции векторных амплитуд на единичные векторы, лежащие в плоскости падения и ортогональные волновым векторам соответствующих волн;  $\rho$  — удельное вращение плоскости поляризации; штрих означает дифференцирование по координате z = d (направление оси *Oz* характеризует единичный вектор **e**<sub>3</sub> на рис. 1); постоянные связи к<sub>1</sub>, к<sub>2</sub> и к<sub>3</sub> рассчитаны с учетом электрооптического и пьезоэлектрического механизмов фоторефрактивного эффекта [9]:

$$\kappa_{1} = -\kappa_{0} \left[ \left( \frac{\Delta B_{11} + \Delta B_{22}}{2} - \Delta B_{12} \right) \cos^{2}\theta + \Delta B_{33} \sin^{2}\theta + \frac{\Delta B_{23} - \Delta B_{13}}{\sqrt{2}} \sin(2\theta) \right],$$
  

$$\kappa_{2} = -\kappa_{0} \left[ \left( \Delta B_{12} + \Delta B_{33} - \frac{\Delta B_{11} + \Delta B_{22}}{2} \right) \frac{\sin(2\theta)}{2} + \frac{\Delta B_{23} - \Delta B_{13}}{\sqrt{2}} \cos(2\theta) \right],$$

$$\kappa_{3} = -\kappa_{0} \left[ \left( \frac{\Delta B_{11} + \Delta B_{22}}{2} - \Delta B_{12} \right) \sin^{2}\theta + \Delta B_{33} \cos^{2}\theta + \frac{\Delta B_{13} - \Delta B_{23}}{\sqrt{2}} \sin\left(2\theta\right) \right],$$
$$\kappa_{0} = \frac{\pi \varepsilon \sqrt{\varepsilon}}{2\lambda}.$$

Здесь  $\Delta B_{mn}$  определяются с помощью выражения (3), ориентационный угол  $\theta$  показан на рис. 1.



Рис. 1. Ориентация вектора решетки **К** относительно кристаллографических осей и рабочей системы координат (**e**<sub>1</sub>, **e**<sub>2</sub>, **e**<sub>3</sub>)

Известно [16], что компоненты обратного тензора диэлектрической проницаемости пьезокристалла  $B_{mn}$  под действием электрического поля голографической решетки  $\mathbf{E}_{SC} = \mathbf{n}E_{SC}$ , где  $\mathbf{n}$  — единичный вектор, параллельный вектору решетки **K**, приобретают приращения

$$\Delta B_{mn} = \Delta B_{mn}^{30} + \Delta B_{mn}^{\phi_{\Pi}} = \left( b_{mn}^{30} + b_{mn}^{\phi_{\Pi}} \right) E_{SC} = b_{mn} E_{SC}, \tag{3}$$

где индекс "эо" соответствует вкладу электрооптического эффекта, "фп" — совместному вкладу фотоупругого и пьезоэлектрического эффектов:

$$b_{mn}^{so} = r_{mnp}^{s} n_p, \tag{4}$$

$$b_{mn}^{\phi \Pi} = p_{mnkq}^E n_k \gamma_{qi} n_p e_{pij} n_j.$$
<sup>(5)</sup>

Формулы (3)—(5) применяются к кристаллам кубической сингонии. Электрооптический и пьезоэлектрический эффекты "разрешены" симметрией кристаллов кубической сингонии лишь для классов 23 и  $\overline{43m}$ . Учтено, что для отличных от нуля компонент тензоров *r*, *e*, *p* и *c* выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} r_{123}^{S} &= r_{132}^{S} = r_{213}^{S} = r_{312}^{S} = r_{312}^{S} = r_{321}^{S} \equiv r, \\ e_{123} &= e_{132} = e_{213} = e_{213} = e_{312} = e_{321} \equiv e_{0}, \\ p_{11}^{E} &= p_{22}^{E} = p_{33}^{E} \equiv p_{1}, p_{12}^{E} = p_{23}^{E} = p_{31}^{E} \equiv p_{2}, p_{13}^{E} = p_{21}^{E} = p_{32}^{E} \equiv p_{3}, \\ p_{44}^{E} &= p_{55}^{E} = p_{66}^{E} \equiv p_{6}, \\ c_{11}^{E} &= c_{22}^{E} = c_{33}^{E} \equiv c_{1}, c_{12}^{E} = c_{13}^{E} = c_{23}^{E} = c_{21}^{E} = c_{31}^{E} = c_{32}^{E} \equiv c_{2}, \\ c_{44}^{E} &= c_{55}^{E} = c_{66}^{E} \equiv c_{3}. \end{aligned}$$

$$(6)$$

Здесь использованы двухиндексные обозначения для компонент тензоров четвертого ранга p и c. Отметим, что для кристаллов класса  $\overline{4}3m$  количество независимых компонент тензора фотоупругости уменьшается, так как  $p_2 = p_3$ .

В результате несложных преобразований на основании (3)-(6) получаем

$$b_{11} = p_1 n_1 R_1 + p_2 n_2 R_2 + p_3 n_3 R_3,$$
  

$$b_{22} = p_1 n_2 R_2 + p_2 n_3 R_3 + p_3 n_1 R_1,$$
  

$$b_{33} = p_1 n_3 R_3 + p_2 n_1 R_1 + p_3 n_2 R_2,$$
  

$$b_{12} = p_4 \left( n_1 R_2 + n_2 R_1 \right) + r n_3,$$
(7)

где

$$b_{13} = p_4 (n_1 R_3 + n_3 R_1) + rn_2,$$
  

$$b_{23} = p_4 (n_2 R_3 + n_3 R_2) + rn_1,$$
  

$$R_1 = \gamma_{11} Q_1 + \gamma_{12} Q_2 + \gamma_{13} Q_3,$$
  

$$R_2 = \gamma_{21} Q_1 + \gamma_{22} Q_2 + \gamma_{23} Q_3,$$
  

$$R_3 = \gamma_{31} Q_1 + \gamma_{32} Q_2 + \gamma_{33} Q_3,$$
  

$$\gamma_{11} = \left(\Gamma_{22} \Gamma_{33} - \Gamma_{23}^2\right) / D,$$
  

$$\gamma_{22} = \left(\Gamma_{11} \Gamma_{33} - \Gamma_{13}^2\right) / D,$$
  

$$\gamma_{13} = \gamma_{31} \left(\Gamma_{12} \Gamma_{23} - \Gamma_{12} \Gamma_{33}\right) / D,$$
  

$$\gamma_{13} = \gamma_{31} \left(\Gamma_{12} \Gamma_{23} - \Gamma_{13} \Gamma_{22}\right) / D,$$
  

$$\gamma_{23} = \gamma_{32} \left(\Gamma_{12} \Gamma_{13} - \Gamma_{11} \Gamma_{23}\right) / D,$$
  

$$D = \Gamma_{11} \left(\Gamma_{22} \Gamma_{33} - \Gamma_{23}^2\right) - \Gamma_{22} \Gamma_{13}^2 - \Gamma_{33} \Gamma_{12}^2 + 2\Gamma_{12} \Gamma_{13} \Gamma_{23},$$
  

$$\Gamma_{11} = c_1 n_1^2 + c_3 \left(n_1^2 + n_2^2\right),$$
  

$$\Gamma_{22} = c_1 n_2^2 + c_3 \left(n_1^2 + n_2^2\right),$$
  

$$\Gamma_{12} = \Gamma_{21} = n_1 n_2 (c_2 + c_3),$$
  

$$\Gamma_{13} = \Gamma_{31} = n_1 n_3 (c_2 + c_3),$$
  

$$\Gamma_{23} = \Gamma_{32} = n_2 n_3 (c_2 + c_3),$$
  

$$Q_1 = 2e_0 n_2 n_3, Q_2 = 2e_0 n_1 n_3, Q_3 = 2e_0 n_1 n_2.$$

Выражения (7) и (8) впервые получены в [16]. Они справедливы для произвольной ориентации вектора  $\mathbf{E}_{SC}$ , определяемой направляющими косинусами  $n_i$  в кристаллофизической системе координат, которая в случае кристаллов кубической сингонии совпадает с кристаллографической.

Если в кристалле среза ( $\overline{110}$ ) записана ненаклонная пропускающая голографическая решетка с вектором **K**, произвольно ориентированным в плоскости среза под углом  $\theta$  к оси [001], то

$$n_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta, n_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta, n_3 = \cos\theta.$$
 (9)

В этом случае компоненты изменения обратного тензора диэлектрической проницаемости:

$$\Delta B_{11} = e_0 E_{SC} \cos\theta \sin^2\theta \frac{(p_1 + p_2)A + p_3 B}{C},$$

$$\Delta B_{22} = e_0 E_{SC} \cos\theta \sin^2\theta \frac{(p_1 + p_3)A + p_2 B}{C},$$

$$\Delta B_{33} = e_0 E_{SC} \cos\theta \sin^2\theta \frac{(p_2 + p_3)A + p_1 B}{C},$$

$$\Delta B_{12} = E_{SC} \cos\theta \left(r - 2e_0 p_4 \frac{A}{C} \sin^2\theta\right),$$
(10)
$$\Delta B_{23} = \frac{E_{SC}}{\sqrt{2}} \sin\theta \left(r - e_0 p_4 \frac{2A \cos^2\theta + B \sin^2\theta}{C}\right),$$

$$\Delta B_{21} = \Delta B_{12}, \Delta B_{32} = \Delta B_{23} = -\Delta B_{31} = -\Delta B_{13},$$

$$A = (c_2 - c_3) \sin^2\theta - 2c_1 \cos^2\theta,$$

$$B = 4(c_2 + c_3) \cos^2\theta - 2c_3 - (c_1 + c_2) \sin^2\theta,$$

$$C = \frac{1}{4} \left[ c_1 \left( c_1 + c_2 \right) - 2 \left( c_2 + c_3 \right)^2 \right] \sin^2 2\theta + c_3 \left( c_1 + c_2 \right) \sin^4 \theta + 2c_3 \left( c_1 \cos^2 \theta + c_3 \sin^2 \theta \right).$$
(11)

Для кристаллов класса  $\overline{43m}$  в силу совпадения  $p_2$  и  $p_3$  выполняется равенство  $\Delta B_{11} = \Delta B_{12}$ .

Результаты и их обсуждение. На рис. 2 представлены зависимости дифракционной эффективности  $\eta$  голограмм, записанных в кристаллических пластинках BSO толщиной d = 8 мм, от ориентационного угла  $\theta$  и удельного вращения  $\rho$  кристалла, а также результаты влияния на дифракционную эффективность голограммы вкладов пьезоэффекта и оптической активности кристалла. Случаю фоторефрактивного кристалла, не проявляющего пьезоэффект, но с учетом оптической активности соответствует рис. 2, *a*. На краю поверхности  $\eta(\theta, \rho)$  при  $\rho = 405$  рад/м наблюдаем "одногорбую" кривую. На рис. 2, *б* при теоретических расчетах учтено совместное действие пьезоэффекта и оптической активности. Как видно "одногорбая" кривая при  $\rho = 405$  рад/м превращается в "двугорбую" при толщине кристалла d = 8 мм.



Рис. 2. Зависимости дифракционной эффективности η голограмм, сформированных в кристалле BSO толщиной 8 мм, от ориентационного угла θ и удельного вращения ρ кристалла: *a* — без учета пьезоэффекта; *б* — с учетом пьезоэффекта

Исследование ориентационных зависимостей дифракционной эффективности голограмм в кристалле BSO фиксированной толщины может быть проведено с помощью сечения поверхностей  $\eta(\theta, d)$ плоскостями d = const. Для более детального анализа зависимости дифракционной эффективности  $\eta$ голограмм от ориентационного угла  $\theta$  и удельного вращения  $\rho$  кристалла рассмотрим сечения поверхностей  $\eta(\theta, d)$ . Результаты теоретических исследований приведены на рис. 3.

Видно, что пьезоэффект и оптическая активность существенно изменяют характер исследуемой зависимости. Игнорирование пьезоэлектрического эффекта может уменьшить рассчитанную дифракционную эффективность голограммы в ~2 раза. Появление двух "горбов" зависимости  $\eta(\theta)$  при толщине кристалла BSO среза ( $\overline{110}$ ) d = 8 мм известно также из работ [8, 12, 17], и это не удается теоретически объяснить без учета пьезоэффекта и оптической активности. При этом, когда толщина кристалла принимает значения, "далекие" от d = 8 мм, зависимости 3 и 4 (рис. 3) перестают быть симметричными относительно ориентационного угла  $\theta = 0$ . Например, при d = 3.45 мм (рис. 4, *a*) и  $\rho > 0$  имеет место смещение локальных максимумов зависимостей 2 и 4 вправо. Если же удельное враще-

ние принимает отрицательные значения ( $\rho < 0$ ), то можно наблюдать "зеркальное отражение" зависимостей относительно  $\theta = 0$  (рис. 4,  $\delta$ ). При необходимости можно изменить знак удельного вращения на противоположный с использованием эффекта Фарадея [18]. На рис. 4 также приведены зависимости  $\eta(\theta)$  при  $\rho = 0$ , поэтому кривые *l* и *2* не изменяют форму при изменении  $\rho$ .



Рис. 3. Зависимости дифракционной эффективности η голограмм, сформированных в кристалле BSO толщиной 8 мм, от ориентационного угла θ и удельного вращения ρ кристалла без учета пьезоэффекта (2, 4) и с учетом пьезоэффекта (1, 3); ρ = 0 (1, 2) и 405 рад/м (3, 4)



Рис. 4. Зависимости дифракционной эффективности η голограмм, сформированных в кристалле BSO толщиной 3.45 мм, от ориентационного угла θ и удельного вращения ρ кристалла без учета пьезоэффекта (3, 4) и с учетом пьезоэффекта (1, 2); ρ=0 (1, 3) и 405 рад/м (2, 4); без изменения знака удельного вращения ρ > 0 (*a*) и с изменением знака удельного вращения на противоположный ρ < 0 (*б*)

Заключение. На примере образца кристалла  $Bi_{12}SiO_{20}$  среза ( $\overline{110}$ ) фиксированной толщины d = 8 мм показана возможность теоретического изучения зависимости дифракционной эффективности η голограмм от ориентационного угла  $\theta$  и удельного вращения  $\rho$  кристалла. Появление двух "горбов" на поверхности среза  $\eta(\theta, d)$  при  $\rho = 405$  рад/м не удается объяснить без одновременного учета пьезоэффекта и оптической активности. Удельные вращения плоскости поляризации разных образцов кристалла  $Bi_{12}SiO_{20}$  различаются. Это связано с тем, что при добавлении перед выращиванием кристаллов различных допантов (Cu, Fe) удельное вращение кристалла может значительно изменяться. Поэтому одновременное исследование влияния обратного пьезоэлектрического эффекта, фотоупругости и удельного вращения кристалла может оказаться полезным и позволит оценить полученные данные для оптимизации выходных энергетических характеристик голограмм. Установлено, что изменение знака удельного вращения кристалла приводит к сдвигу локальных максимумов дифракционной эффективности голограмм влево или вправо.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования Республики Беларусь (задание 1.2.01 Государственной программы научных исследований "Фотоника, опто- и микроэлектроника").

- [1] А. А. Изванов, А. Е. Мандель, Н. Д. Хатьков, С. М. Шандаров. Автометрия, № 2 (1986) 79—84
- [2] С. И. Степанов, С. М. Шандаров, Н. Д. Хатьков. ФТТ, 29, № 10 (1987) 3054—3058
- [3] В. В. Шепелевич. ЖТФ, 55, № 6 (1985) 1201—1203
- [4] Ф. И. Федоров. Теория гиротропии, Минск, Наука и техника (1976)
- [5] Б. В. Бокуть, А. Н. Сердюков. Основы теоретической кристаллооптики, ч. 2, Гомель, ГГУ (1977)
- [6] В. В. Шепелевич. ЖТФ, 56, № 3 (1986) 618—619
- [7] Л. М. Барковский, Ф. И. Федоров. Кристаллография, 10, № 2 (1965) 174—180
- [8] А. Е. Мандель, С. М. Шандаров, В. В. Шепелевич. Письма в ЖТФ, 14, № 23 (1988) 2147—2151
- [9] А. Е. Мандель, С. М. Шандаров, В. В. Шепелевич. Опт. и спектр., 67, № 4 (1989) 819-822
- [10] V. V. Shepelevich, S. M. Shandarov, A. E. Mandel. Ferroelectrics, 110 (1990) 235-249
- [11] A. E. Mandel, S. M. Shandarov, V. V. Shepelevich. Topical Meeting on Photorefractive Materials, Effects, and Devices II. Technical digest, January 17–19, 1990 Aussous, France (1990) 105–108
- [12] В. И. Волков, Ю. Ф. Каргин, Н. В. Кухтарев, А. В. Привалко, Т. И. Семенец, С. М. Шандаров, В. В. Шепелевич. Квант. электрон., 18, № 10 (1991) 1237—1240
- [13] P. Günter, M. Zgonik. Opt. Lett., 16 (1991) 1826–1828
- [14] N. V. Kukhtarev, T. I. Semenets, P. Hribek. Ferroelectrics Lett. Sec., 13 (1991) 29-35
- [15] М. П. Петров, С. И. Степанов, А. В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике, СПб., Наука (1992)
- [16] С. М. Шандаров, В. В. Шепелевич, Н. Д. Хатьков. Опт. и спектр., 70, № 5 (1991) 1068—1070
- [17] В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич, С. М. Шандаров, П. И. Ропот, А. Е. Загорский. Изв. вузов. Физика, 58, № 10 (2015) 74—79
- [18] В. В. Шепелевич, П. И. Ропот. Способ считывания пропускающей голограммы, записанной в кубическом оптически активном фоторефрактивном кристалле со структурой силленита в диффузионном режиме, патент 13572 от 30.08.2010, Национальный центр интеллектуальной собственности (2010) 1—3